

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2011年6月3日(03.06.2011)

PCT

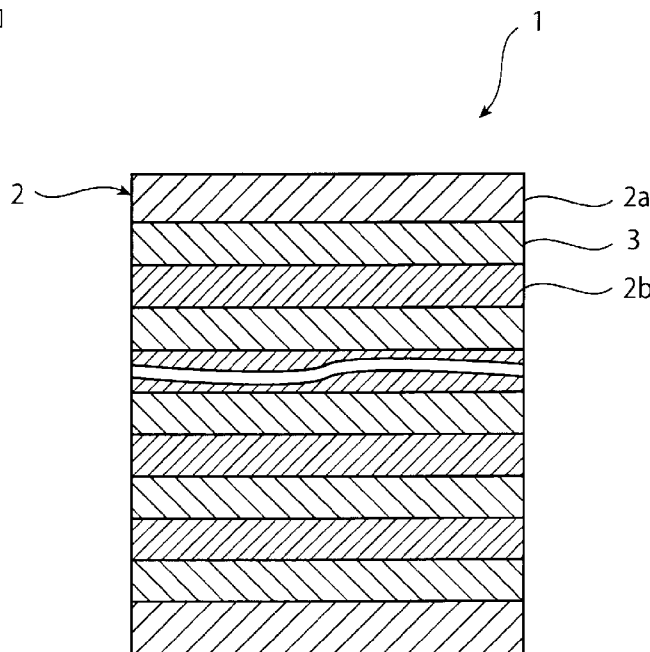
(10) 国際公開番号
WO 2011/065316 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/223 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2010/070764
- (22) 国際出願日: 2010年11月22日(22.11.2010)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2009-265916 2009年11月24日(24.11.2009) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日本電気硝子株式会社(NIPPON ELECTRIC GLASS CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5208639 滋賀県大津市晴嵐二丁目7番1号 Shiga (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 鈴木 良太 (SUZUKI, Ryota) [JP/JP]; 〒5208639 滋賀県大津市晴嵐二丁目7番1号 日本電気硝子株式会社内 Shiga (JP). 馬屋原 芳夫 (UMAYAHARA, Yoshio) [JP/JP]; 〒5208639 滋賀県大津市晴嵐二丁目7番1号 日本電気硝子株式会社内 Shiga (JP).
- (74) 代理人: 目次 誠, 外 (METSUGI, Makoto et al.); 〒5400012 大阪府大阪市中央区谷町1丁目5番4号 大同生命ビル6階 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: DOPANT HOST AND PROCESS FOR PRODUCTION THEREOF

(54) 発明の名称: ドーパントホスト及びその製造方法

[図1]



volatilization layer that is arranged in the inside of the laminate.

(57) Abstract: Disclosed is a dopant host, of which the volatilization volume of B_2O_3 is rarely reduced over time, and which can exhibit a good B_2O_3 volatilization ability for a long period. The dopant host comprises a laminate which comprises: a boron component volatilization layer comprising, in mol%, 30 to 60% of SiO_2 , 10 to 30% of Al_2O_3 , 15 to 50% of B_2O_3 and 2 to 15% of RO (wherein R represents an alkali earth metal element); and a heat-resistant layer comprising, in mol%, 8 to 40% of SiO_2 , 40 to 85% of Al_2O_3 , 5 to 30% of B_2O_3 and 0.5 to 7% of RO (wherein R represents an alkali earth metal element). At least one of the outermost layers of the laminate is composed of the boron component volatilization layer. The laminate additionally comprises a boron component volatilization layer as mentioned above in the inside thereof. The B_2O_3 content in the boron volatilization layer that constitutes the above-mentioned at least one of the outermost layers of the laminate is lower than that in the boron component

(57) 要約:

[続葉有]